

设备分区	名称、型号	设备责任人	联系方式
注入与热模区	离子注入机/IMPL-1	张强	qzhang@iat.ustc.edu. cn
	管式炉-氧化退火炉/ Ox-1-Annl Ox-2-Dry Ox-3-Wet		
	管式炉-卧式 LPCVD/ CVD-1-TEOS CVD-2-Poly CVD-3-SiN		
	RTP 真空快速退火炉/RTP-1		
	RTP 真空快速退火炉/RTP-2		

干刻区	通用介质刻蚀机/ICP-1-Gen	周旭	xuzhou@iat.ustc.edu. cn
	高温介质刻蚀机/ICP-2-HT		
	深硅刻蚀机/DRIE-1		
	硅相关介质刻蚀机/RIE-1-Si		
	通用金属刻蚀机/ICP-3-M		
	低损伤金属刻蚀机/ICP-4-MLD		
	离子束刻蚀机 RIBE/RIBE-1		
	等离子去胶机/Asher-1-RF		
	等离子去胶机/Asher-2-MW		
化学镀膜区	PEALD/ICP-1-Gen	张丽媛	LiyuanZhang@iat. ustc. edu. cn
	热型原子层沉积系统/ALD-2-Ox		
	热型原子层沉积系统/ALD-3-MNT		
	PECVD/PECVD-1		

	ICPCVD/ICPCVD-1		
	MPCVD/MPCVD-1		
	原子层沉积/ALD-4		
无机湿法台区	双轴划片机/Dicer-1	冯建方	jffeng@iat.ustc.edu.cn
	化学机械抛光系统（CMP）/CMP-1		
	前道-槽式晶圆清洗/WS-1-Etch		
	前道-槽式酸刻蚀工艺台 /WS-2-Clean		
	后道-自定义 HF 刻蚀工艺台 /WS-3-HF		
	后道-自定义碱刻蚀工艺台 1/WS-4-Base		
	后道-自定义碱刻蚀工艺台		

	2/WS-5-Base		
	后道-自定义酸刻蚀工艺台 1/WS-6-Acid		
	后道-自定义酸刻蚀工艺台 2/WS-7-Acid		
有机湿法台区	后道-自定义有机工艺台 1/WS-8-Org	冯建方	jffeng@iat.ustc.edu.cn
	后道-自定义有机工艺台 2/WS-9-Org		
	前道-槽式有机工艺台/WS-10-Org		
黄光区	前道-光刻工艺台/WS-11-Litho	万超凡	cfwan@iat.ustc.edu.cn
	后道-光刻工艺台/WS-12-Litho		
	紫外曝光机/ MA-1-Suss		

	紫外曝光机/MA-2-MT		
	激光直写曝光机/ LDW-1	袁威	yuanwei@iat.ustc.edu.cn
高精度黄光区	EBL 电子束曝光机/EBL-1	张强	qzhang@iat.ustc.edu. cn
	晶圆键合机/Bonder-1-Suss	万超凡	cfwan@iat. ustc. edu. cn
	高精度贴片机/Bonder-2-Femto	袁威	yuanwei@iat.ustc.edu.cn
量测区	扫描电子显微镜/SEM-1	万超凡	cfwan@iat. ustc. edu. cn
	原子力显微镜/ AFM-2-Bruker AFM-1-Park	袁威	yuanwei@iat.ustc.edu.cn
	椭偏仪/Ellipso-1	张强	qzhang@iat.ustc.edu. cn
	台阶仪/Profiler-1	万超凡	cfwan@iat. ustc. edu. cn
	光学显微镜(10 台)		
	激光划片机/Dicer-2-Laser	袁威	yuanwei@iat.ustc.edu.cn

	膜厚仪/Film-1-F50	万超凡	cfwan@iat.ustc.edu.cn
	半自动引线键合机/WB-1		
PVD 区	新材料沉积磁控溅射/SPT-1-1-X	袁威	yuanwei@iat.ustc.edu.cn
	金属沉积用磁控溅射/SPT-1-2-M		
	氧化物/氮化物沉积用磁控溅射 /SPT-1-3-ON		
	三室磁控溅射仪		
	压电材料沉积机/SPT-3-Piezo		
	双电子束 PVD/ EVP-1-ebeam		
	高真空蒸发镀膜机（热蒸发系统） /EVP-2-thermal		